(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-259614

(43)公開日 平成8年(1996)10月8日

(51) Int.Cl. ⁶	酸別記号	庁内整理番号	FΙ		-	技術表示箇所
C08F 2/48	MDH		C08F	2/48	MDH	
B 2 9 C 67/00		8413-4F	B 2 9 C	67/00		
C08J 3/28		•	C 0 8 J	3/28		
G03F 7/004	502		G03F	7/004	502	
7/029				7/029		
		審査請求	未請求 請		FD (全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-84666		(71)出題	人 390023	146	
				チパー	ガイギー アクチエ	ンゲゼルシャフ
(22)出顧日	平成8年(1996)3	月13日		ト		
				CIB	A-GEIGY A	KTIENGE
(31)優先権主張番号	717/95			SEL	LSCHAFT	
(32)優先日	1995年3月13日			スイス	国 4002 パーゼル	クリペックシ
(33)優先権主張国	スイス (CH)			ュトラ	ーセ 141	
			(72)発明	渚 アドリ	アン シュルトヘス	
				スイス	国, 1734 テントリ	ンゲン、ウフ
	•				ベルク 22	, , ,
			(74)代理	人 弁理士	萼 経夫 (外1	名)
		1				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 所望でない早期重合に対する液状放射線 - 硬化性組成物の安定化

(57)【要約】

【課題】 カチオン重合性化合物およびカチオン重合用 光開始剤をベースとする液状放射線-硬化性組成物の、 重合の早期開始に対する安定化の方法の提供。

【解決手段】 塩基性イオン交換体を少なくとも一定期間、カチオン重合性化合物およびカチオン重合用光開始 剤からなる液状放射線ー硬化性組成物と接触させ、好ましくは放射線ー硬化の開始の前に、少なくとも上記組成物の放射線に接触するようになる部分から上記イオン交換体を取り除く方法ならびに上記方法に相当する組成からなる組成物および上記安定化の方法を利用して行うステレオリソグラフィーによる立体製品の製造。

【特許請求の範囲】

重合の早期開始に対してカチオン重合性 化合物およびカチオン重合用光開始剤からなる液状放射 線ー硬化性組成物を安定化する方法であって、塩基性イ オン交換体を少なくとも一定期間、上記組成物と接触さ せる方法。

【請求項2】 放射線-硬化の開始の前に、少なくとも 放射線-感受性組成物の放射線に接触するようになる部 分から塩基性イオン交換体を取り除く、請求項1に記載 の方法。

【請求項3】 イオン交換体を液状放射線-硬化性組成 物と接触させる前に、溶解性の塩基性不純物をイオン交 換体材料から取り除く、請求項1または2に記載の方 法。

【請求項4】 使用されるイオン交換体がスチレン、ジ ビニルベンゼンおよびジメチルアミノメチルスチレンの 架橋コポリマーである、請求項1ないし3のいずれかー 項記載の方法。

【請求項5】 塩基性イオン交換体を放射線-硬化性組 成物に、その製造工程の終わりに添加し、輸送および貯 20 蔵の間に上記組成物に直接接触したままにし、そして組 成物の適用の直前に取り除く、請求項1ないし4のいず れか一項記載の方法。

【請求項6】 塩基性イオン交換体は、放射線-硬化性 組成物と接触している間、イオン交換体に対しては全く 不透過性であるが硬化性組成物に対しては少なくとも一 つの領域にて透過性である容器中にある、請求項1ない し5のいずれか一項記載の方法。

【請求項7】 カチオン重合性化合物、カチオン重合用 光開始剤および早期重合に対して該化合物を安定化する のに十分な量の塩基性有機イオン交換体からなる液状放 射線一硬化性組成物。

【請求項8】 カチオン重合性化合物およびカチオン重 合用光開始剤からなる液状放射線-硬化性組成物を使用 するステレオリソグラフィーによる立体製品(three-dim ensional article) の製造方法であって、塩基性イオン 交換体を少なくとも一定時間、該組成物と接触させる方 法。

【請求項9】 放射線硬化の開始前に、放射線-感受性 組成物の少なくとも放射線と接触させるようになる部分 40 からイオン交換体を取り除く、請求項8に記載の方法。

【請求項10】 イオン交換体を液状放射線-硬化性組 成物と接触させる前に、溶解性の塩基性不純物をイオン 交換体材料から取り除く、請求項8または9に記載の方

【請求項11】 少なくとも一定時間、イオン交換体が ステレオリソグラフィー槽内に装入される容器内にあ り、該容器はイオン交換体に対しては全く不透過性であ り、硬化性組成物に対しては少なくとも一つの領域にて

の方法。

【請求項12】 容器がステレオリソグラフィー槽内に ある間、該槽中の液状組成物と該容器間に相対運動(re lative movement)が起こる、請求項11に記載の方法。

2

【請求項13】 液状放射線-硬化性組成物中のカチオ ン重合性化合物が少なくとも 1種のエポキシ樹脂であ る、請求項8ないし12のいずれか一項記載の方法。

【請求項14】 液状放射線-硬化性組成物はまた、フ リーラジカルによって硬化できる化合物の少なくとも1 10 種、またはそれらの化合物の2もしくはそれ以上の混合 物、ならびにフリーラジカル重合用の光開始剤を含む請 求項13に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カチオン重合性化 合物およびカチオン重合用光開始剤をベースとする液状 放射線-硬化性組成物の、重合の早期開始に対する安定 化の方法;相当する安定化組成物および上記安定化が利 用されるステレオリソグラフィーによる立体製品(three -dimensional article) の製造に関する。

[0002]

【従来の技術】カチオン重合性化合物およびカチオン重 合用光開始剤からなる液状放射線-硬化性組成物は産業 上広く普及されそして例えば放射線-硬化性塗料、フォ トレジストとしてまたはステレオリソグラフィーによる 立体製品の製造のため使用されている。このカチオン重 合用光開始剤はこれらの組成物において、強い潜酸(la tent acid)によりこれらの化合物内で形成され、即ち照 射において光反応を受けて強酸を形成し、それは次にカ チオン重合を開始する。 30

【0003】しかし、上記放射線-硬化性組成物が実際 に使用される場合、カチオン重合が早期に、即ち照射の 前においてさえも始まるため厄介な問題がしばしば生じ る。これは一般に組成物中の早すぎる酸の形成による。 望ましくない酸の形成は、例えば、水分、熱、光もしく は散乱光への意図しない曝露等のための光開始剤の分解 によるまたは意図しない酸の移動によることがあり得 て、後に使用できなくなるような、組成物の粘度の大き な増加をしばしば生じる。

【0004】このタイプの安定性の問題は、カチオン重 合化合物およびカチオン重合用光開始剤をベースとする 組成物を使用するステレオリソグラフィーによる立体製 品の慣用の製造において特に、生ずる。例えば、US-A-4575330に非常に詳細に記載されているよう なステレオリソグラフィー法においては、UV/VIS 光源を使用して、組成物の層を画像様(imagewise)、即 ち層が照射された領域における所望の層厚に固体化する まで、全体の領域にわたるかあるいは(直線的またはベ クトル的な走査を伴う) 予め決められたパターンのいず 透過性である、請求項8ないし10のいずれか一項記載 50 れかに最初に照射することにより、立体製品は液状放射

線-硬化性組成物からの層において構築される。液状放 射線-硬化性組成物の新しい層は次に既に固体化した層 上に形成されおよび同様に全ての領域または予め決めら れたパターンに照射されて、第一層に付着する第二の固 体化層を形成する。この操作は既に硬化した材料のさら なる硬化性組成物による被覆とこの液状層の画像様の照 射を繰り返すように続けられ、最後に、未だ、完全に硬 化していないが、十分に固体化した「未硬化成形品(gre en part)」としてまた知られる、所望の形の製品を得る が;上記未硬化成形品は液状組成物を含む槽から取り出 されそして最後に異なる方法、加熱および/または他の 照射により硬化される。プレフォームの取り出し後、ス テレオリソグラフィー槽は、必要ならば新しい硬化性組 成物を補給され、そして他の未硬化成形品の製造のため に使用される。経済的理由のため通常補充のみされる、 カチオン硬化性ステレオリソグラフィー槽は不十分な寿 命のみを有しおよび、ほんの比較的短期間後には、もは や許容できない粘度の増加を示すことが今や見出されて いて、何故ならば、特にステレオリソグラフィーは、そ こからは高ー粘度材料はもはや十分な程度に流延しな い、複雑な形、例えば狭いギャップ、角または非常に小 さい孔を介してのみ外側と連結される内部キャビティを 伴う形、である製品の製造に対して精密に使用されるか らである。

【0005】EP-A-0126712は既にカチオン 重合性化合物およびカチオン重合用光開始剤に基づく放 射線硬化性組成物の保存寿命は、弱有機性塩基、例えば ニトリル、アミド、ラクトンまたは尿素誘導体の少量を 加えることにより増加させることを記載する。しかしな がら、このタイプの安定剤は組成物の感光性を減少させ 30 るほど大量でない場合には、不十分な程度にのみ使用で きる。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、重合の早期開始に対してカチオン重合性化合物およびカチオン重合用光開始剤からなる液状放射線-硬化性組成物を安定化する方法であって、少なくとも一定期間、塩基性イオン交換体を上記組成物と接触させる方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】新規な方法は、放射性感受性組成 40 物に溶解しまたはそれとともに永久的に混和する安定剤をベースとするいずれかの低分子量安定剤を使用しないが、代わりに固体塩基性イオン交換体材料の形態で不溶性の安定剤を使用するため、液状組成物の所望でない酸粒子を捕捉し、同時に従来の安定剤の短所を回避する。塩基性イオン交換体が、照射の間、放射線と接触するようになる放射線ー硬化性組成物の領域内に残る場合、感光性の減少は近接するイオン交換体粒子の付近に限定され、従って全体として組成物の硬化に関する限り重要でない。 50

【0008】しかし、固体塩基性イオン交換体の使用はまた、硬化性組成物と塩基性安定剤の接触を、空間的または時間的に、該組成物の照射から分離できるようにする。従って、上記方法において放射線硬化の開始前に、少なくとも放射線感受性組成物の放射線と接触するようになる、即ち放射線がそれに透過する部分から、イオン交換体を除去するのは好ましい。

【0009】塩基性イオン交換体は以前から、当業者によく知られ、そして例えば、Ullmanns Encyclopadie der Technischen Chemie, 4th Edn, Verlag Chemie, Wein heim1977, Vol.13,pp 279 ff またはUllmann's Encyclo paedia of Industrial Chemistry, 5th Ed., Verlag Chemie, Weinheim 1989, Vol.14,pp 393 ffに詳細に記載されている。それらはまた種々の形態で市販もされている。本発明のためには、好ましいものは有機塩基性イオン交換体、即ち塩基性基を含むポリマーで与えられるものである。技術分野では強塩基性および弱塩基性イオン交換体の間に区別がなされる。強塩基性有機イオン交換体は、例えばスチレン、ジビニルベンゼンおよび水酸化トリメチル(スチリルメチル)アンモニウムもしくは水酸化ジメチル(2ーヒドロキシエチル)スチリルメチルアンモニウムの架橋コポリマーである。

【0010】本発明の目的のために、特に好ましいものは弱塩基性有機イオン交換体、特にスチレン、ジビニルベンゼンおよびジメチルアミノメチルスチレンの架橋コポリマーで与えられるものである。

【0011】特に市販されるタイプの塩基性イオン交換体は、しばしば未だ水および可溶性塩基性不純物を含む。この形態でイオン交換体を使用することが可能であるが、該交換体を液状放射線一硬化性組成物に接触させる前に、可溶性塩基性不純物はイオン交換材料から好ましくは除去される。これは、例えば、イオン交換樹脂を特に何度も、極性有機溶媒、例えばエタノールまたは酢酸エチルにより洗浄すること、およびそれが使用され、そして液状放射線一硬化性組成物と接触するようになる前に注意深く乾燥することにより達成される。洗浄されたイオン交換体が使用される場合、硬化性組成物の粘度は低いままでありおよびその感光性は特別に長期に、特に高い。

【0012】市販のイオン交換体は一般に顆粒の形態で供給される。しかし、高い比表面積を有する形態、例えばフィルムもしくはロッドの形態で、または代わりに、放射線一硬化性組成物がそれらを通して例えばポンプで送ることのできるようなパイプもしくは管の形態での、他の使用形態におけるイオン交換体材料を使用する新規な方法を行うこともまた考えられる。

【0013】上記で言及した、硬化性組成物と塩基性イオン交換体との接触の、空間的または時間的における、該組成物の照射からの分離は例えば露光前に、例えばろ 50 過により、沈降によりまたは他の適当な液体および固体 を分離する方法により硬化性組成物から完全に分離する ことによって行われる。概説される手順は、一般的に利 用可能でありそして特に、塗料またはフォトレジスト組 成物のような放射線-硬化性被覆材料を安定化するのに 適当である。塩基性イオン交換体は放射線-硬化性組成 物に、例えば製造工程の最後に、例えばドラム内への装 填中に添加され、そして例えば使用するまで、即ち特に 輸送および貯蔵の間に輸送コンテナ中に機械的に固定す ることにより、直接的に組成物と接触したままにする。 上述したようにイオン交換体材料はまた組成物に残して 10 おくことも可能であるが、照射の前に、好ましくは照射 前の可能な限り遅くに、とりわけ硬化性組成物の適用、 例えば相当する被覆材料の基材への適用直前に取り除く ことが好ましい。従って、本発明はまたカチオン重合性 化合物、カチオン重合用の光開始剤および早期重合に対 して組成物を安定化させるのに十分な量の塩基性、特に 弱塩基性、有機イオン交換体を含む液状放射線-硬化性 組成物に関する。

【0014】新規な方法の他の実例では、塩基性イオン交換体は、それが硬化性組成物と接触する間に、イオン交換体に対して全く不透過性であるが、少なくともある領域で硬化性組成物に対して透過性である容器内にある。この容器は例えば、少なくとも1つ、好ましくは2つの、特に向かい合った、その孔径がイオン交換体が容器から漏れ出られないように小さい、多孔壁を有するカートリッジがあり得る。この手順は最終使用者がイオン交換体と硬化性組成物と極めて簡単に分離できるようにする。

【0015】イオン交換体の必要量がイオン交換体の能力および放射線ー硬化性液体とのその接触の強度および期間に依存する。この量は少しの簡単なルーチン試験により当業者によって決定できる。上記イオン交換体は好ましくは、その全体の有益な能力が放射線ー硬化性組成物中にある全てのカチオン重合用開始剤により形成され得る酸の量の5ないし80%、好ましくは5または50%に等しいような量で使用される。

【0016】新規の安定化方法がそれに対して適当である液状放射線ー硬化性組成物は、単体で、またはカチオン的にもしくは他の機構、例えばフリーラジカルにより重合できる他の化合物の少なくとも1つとの混合物の形態での何れかの慣用のカチオン重合性有機化合物の全てを含むことができる。これらは例えば、モノオレフィンおよびジオレフィン例えばイソブチレン、ブタジエン、イソプレン、スチレン、 α -メチルスチレン、ジニルベンゼン、N-ニルピロリドン、N-ピニルカルバゾールおよびアクロレイン、あるいはビニルエーテル、例えばメチルビニルエーテル、イソブチルピニルエーテル、トリメチルプロパントリビニルエーテル、エチレングリコールジビニルエーテル;環状ピニルエーテル、例えば3,4-ジヒドロー2ーホルミルー2H-ピラン(二量50

6

体アクロレイン) および2-ヒドロキシメチルー3,4 -ジヒドロー2H-ピランの3, 4-ジヒドロー2H-ピランー2-カルポン酸エステルならびにピニルエステ ル、例えば酢酸ビニルおよびステアリン酸ビニルような カチオン機構により重合できる、エチレン性不飽和化合 物を含む。それらはまた、カチオン重合性複素環化合 物、例えば、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、 エピクロロヒドリン、グリシジルエーテルまたは、一価 アルコールまたはフェノール例えば、n-ブチルグリシ ジルエーテル、n-オクチルグリシジルエーテル、フェ ニルグリシジルエーテルおよびクレジルグリシジルエー テル:グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレ ート、スチレンオキシドおよびシクロヘキサンオキシ ド:3,3-ジメチルオキセタンおよび3,3-ジ(ク ロロメチル) オキセタンのようなオキセタン;テトラヒ ドロフラン;ジオキソラン、トリオキソランおよび1, 3, 6-トン、 γ - パレロラクトンおよび ϵ - カプロラクトンの ようなラクトン;スピロエーテルカーポネートスピロエ ーテルエステル;エチレンスルフィドおよびプロピレン スルフィドのようなチイラン;エポキシ樹脂;側鎖にグ リシジル基を含む線状および枝分かれポリマー;例えば ポリアクリレートおよびポリメタクリレートグリシジル エーテルのホモポリマーおよびコポリマーである。他の 適当なカチオン重合性化合物は、メチロール化合物であ り、それらはアミノ樹脂例えばアミドのN-ヒドロキシ メチルーNーメトシメチルー、N-n-プトキシメチル -およびN-アセトキシメチル誘導体、またはアミド様 化合物例えば環状尿素、例えばエチレン尿素(イミダゾ リン-2-オン)、ヒダントイン、ウレオン (テトラヒ ドロオキサジアジンー4ーオン)、1,2-プロピレン 尿素(4-メチルイミダゾリジン-2-オン)、1,3 ープロピレン尿素 (ヘキサヒドロー2H-ピリミドー2 ーオン)、ヒドロキシプロピレン尿素(5-ヒドロキシ $^{\text{A+}}$ サヒドロー2Hーピリミドー2ーオン)、1,3, 5-メラミン、ならびにアセトグアナミン、ベンゾグア ナミンおよびアジポグアナミンのような他のポリトリア ジンを含む。所望ならば、N-ヒドロキシメチルおよび N-アセトキシメチル基の両方を含むアミノ樹脂、例え ばヒドロキシ基の1ないし3個がメチル基によりエーテ ル化されている、ヘキサメチルメラミンが使用され得 る。他の適当なメチロール化合物はフェノール樹脂、特 にフェノールおよびアルデヒドから製造されたレゾール である。この目的に適当なフェノール類はフェノール自 体、レゾルシノール、2,2-ビス(p-ヒドロキシフ ェニル)プロパン、pークロロフェノール;oー、mー またはp-クレゾール、キシレノール、p-第三プチル フェノールおよび p ーノニルフェノールのような 1 ない し9個の炭素原子数を有するアルキル基の1ないし2個 により置換されたフェノールならびにまたフェニル置換

されたフェノール、特にp-フェニルフェノールであ る。フェノールにより縮合されるアルデヒドは好ましく はホルムアルデヒドであるが、他のアルデヒド例えばア セトアルデヒドおよびフルフラール、もまた適当であ る。所望ならばこのような硬化性フェノールーアルデヒ ド樹脂の混合物が使用できる。

【0017】特に重要なカチオン重合性化合物は、分子 中に平均1より多くの1,2-エポキシド基を含む、エ ポキシ樹脂である。このような樹脂は、脂肪族、芳香 族、脂環式、アルアリファチック (araliphatic)または 10 複素環式構造を有し、それらは側鎖としてエポキシド基 を含むか、あるいはこれらのグループは脂肪族環系また は複素環系の一部分を形成するものである。これらのタ イプのエポキシ樹脂は一般的用語として公知でありそし て市販されている。以下に示すものは、このタイプのエ ポキシ樹脂の実例により言及される得るべきものであ る:

【0018】1)分子中にカルポキシル基を少なくとも 2個含む化合物とエピクロロヒドリンまたはグリセロー ν ジクロロヒドリンまたは β -メチルエピクロロヒドリ 20 ンとを反応させることによって得られるポリグリシジル およびポリ (βーメチルグリシジル) エステル。反応は 塩基の存在下で都合良く行われる。分子中に少なくとも 2個のカルボキシル基を含む化合物は例えば、脂肪族ポ リカルボン酸であってよい。このようなポリカルボン酸 の例は、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スペリ ン酸、アゼライン酸、セバシン酸または2量体化もしく は3量体化リノレン酸である。しかし、テトラヒドロフ タル酸、4-メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒド ロフタル酸、または4-メチルヘキサヒドロフタル酸の ような脂環式ポリカルボン酸もまた使用可能である。芳 香族ポリカルポン酸もまた使用でき、例えば、フタル 酸、イソフタル酸、トリメリット酸およびピロメリット 酸である。カルポキシル末端を有する付加物、例えばト リメリット酸およびポリオール、例えばグリセロールも しくは2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル) プロパンが使用され得る。

【0019】II)遊離アルコール系ヒドロキシル基およ び/またはフェノール系ヒドロキシ基を少なくとも2個 含む化合物と適当な置換されたエピクロロヒドリンと を、アルカリ条件下または酸触媒の存在下で反応させ、 続いてアルカリで処理することによって得られるポリグ リシジルもしくはポリ (β-メチルグリシジル) エーテ ル。このタイプのエーテルは例えば、非環式アルコール から、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコー ルおよび高級ポリ(オキシエチレン)グリコール、プロ パン-1,2-ジオールまたはポリ(オキシプロピレ ン) グリコール、プロパン-1,3-ジオール、ブタン -1,4-ジオール、ポリ(オキシテトラメチレン)グ リコール、ペンタン-1,5-ジオール、ヘキサン-

1, 6-ジオール、ヘキサン-2, 4, 6-トリオー ル、グリセロール、1,1,1-トリメチロールプロパ ン、ピストリメチロールプロパン、ペンタエリスリトー ル、ソルビトールから、ならびにポリエピクロロヒドリ ンから誘導されたものである。このエーテルはまた、 1,3-もしくは1,4-ジヒドロキシシクロヘキサ ン、ピス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)メタン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロバ ンまたは1,1-ビス(ヒドロキシメチル)シクロヘキ セー3ーエンのような脂環式アルコールから誘導されて いてもよく、あるいは、それらはN, N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)アニリンまたはp,p'-ビス(2 ーヒドロキシエチルアミノ)ジフェニルメタンのような

8

た、単核フェノールから、例えばレゾルシノールまたは ヒドロキノンから誘導されていてもよく、あるいはそれ らは多核フェノール例えばビス(4-ヒドロキシフェニ ル) メタン [ピスフェノールF]、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン〔ビスフェノールA〕、 あるいは酸性条件下で得られるアルデヒドと、フェノー

芳香族核を含んでいてよい。グリシジルエーテルはま

ルまたはクレゾールとの縮合生成物、例えばフェノール ノポラック、クレゾールノポラックから、誘導され得

【0020】III) エピクロロヒドリンと少なくとも2 つのアミノ水素原子を含むアミンとの反応生成物の脱塩 酸化により得られるポリー(N-グリジル)化合物。こ れらのアミンは代表的にはn-ブチルアミン、アニリ ン、トルイジン、m-キシリレンジアミン、ビス(4-アミノフェニル) メタン、またはビス (4-メチルアミ ノフェニル) メタンである。しかし、ポリ (N-グリシ ジル) 化合物はまた、エチレン尿素または1,3-プロ ピレン尿素のようなシクロアルキレン尿素のN, N'-ジグリシジル誘導体および5、5-ジメチルヒダントイ ンのようなヒダントインのジグリシジル誘導体をも含

【0021】IV)適当なポリ(S-グリシジル)化合物 の例は、例えばエタンー1、2ージオールのようなジチ オールもしくはビス (4-メルカプトメチルフェニル) エーテルから誘導されたジ (S-グリシジル) 誘導体で 40 ある。

【0022】V) エポキシド基が非環式または複素環系 の一部を形成する、エポキシド化合物の例は、ビス (2,3-エポキシシクロペンチル)エーテル、2,3 -エポキシシクロペンチルグリシジルエーテル、1,2 ~ビス(2,3-エポキシシクロペンチルオキシ)エタ ン、ピス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)メタンジグ リシジルエーテル、2,2-ビス(4-ヒドロキシシク ロヘキシル)プロパンジグリシジルエーテル、3,4-エポキシシクロヘキシルメチルー3,4-エポキシシク 50 ロヘキサンカルボキシレート、3,4-エポキシー6メチルーシクロヘキシルメチルー3,4-エポキシー6 -メチルシクロヘキサンカルポキシレート、ジー(3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル) ヘキサンジオエー ト、ジー(3,4-エポキシー6-メチルーシクロヘキ シルメチル) ヘキサンジオエート、エチレンピス (3, 4-エポキシーシクロヘキサンカルボキシレート)、エ タンジオールジー(3,4-エポキシシクロヘキシルメ チル) エーテル、ビニルシクロヘキセンジオキシド、ジ シクロペンタジエンジエポキシドまたは2-(3,4~ エポキシシクロヘキシル-5, 5-スピロ-3, 4-エ 10 ポキシ) シクロヘキサン-1, 3-ジオキサンである。 【0023】しかしながら、また1,2-エポキシド基 が異なるヘテロ原子または官能基に結合しているエポキ シ樹脂を使用することも可能である。該化合物は、例え ば、4-アミノフェノールのN, N, O-トリグリシジ ル誘導体、サリチル酸のグリシジルエーテルグリシジル エステル、N-グリシジル-N'-(2-グリシジルオ キシプロピル) -5,5-ジメチルヒダントインまたは 2-グリシジルオキシー1、3-ビス(5,5-ジメチ ルー1ーグリシジルヒダントイン-3-イル)プロパン である。このようなエポキシ樹脂とエポキシ樹脂用硬化 剤との液体予備反応された付加物もまた適当である。

【0024】カチオン重合用光開始剤は同様にこの目的 のために技術的に公知である全ての化合物である。それ らは例えば、弱い求核性のアニオンとのオニウム塩を含 む。その例はハロニウム塩、イオドジル塩またはスルホ ニウム塩であり、それはEP-A-153904号に記 載されており、スルホキソニウム塩は、例えばEP-A -35969、44274、54509および1631 4号に開示されて、また、ジアゾニウム塩、例えばUS -A-3708296号に開示されている。他のカチオ ン性光開始剤は、メタロセン塩、例えばEP-A-94 914および94915号に開示されたようなものであ る。他の慣用のオニウム塩開始剤および/またはメタロ セン塩について研究は "UV-Curing, Science and Techn ology", (Editor: S.P. Pappas, Technology Marketing C orp.,642 Westover Road, Standard, Conneticut, USA) または"Chemistry & Technology of UV & EB Formulati onfor Coatings, Inks & Paints", Vol. 3(edited by P.K.T.Oldring)に記載されている。

【0025】特に適当なカチオン重合用の光開始剤は次式(1)、(2) および(3)

$$\begin{bmatrix} G_1 - I - G_2 \end{bmatrix}^{\bigoplus} \begin{bmatrix} L Q_w \end{bmatrix}^{\bigoplus}$$
 (1)

$$\begin{bmatrix} G_3 - I \\ G_4 \end{bmatrix} - G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{Q_w} \\ D_{Q_w} \end{bmatrix}$$
 (2)

$$\begin{bmatrix} G_5 \\ S - G_7 \end{bmatrix} \bigoplus_{ \begin{bmatrix} LQ_w \end{bmatrix}} \bigoplus$$
 (3)

(式中 G_1 , G_2 , G_3 , G_4 , G_5 , G_6 および G_7 が、未置換または適した基により置換された炭素原子数 G_7 ないし G_7 を表し、Lがホウ素原子、リン原子、ヒ素原子またはアンチモン原子を表し、Qがハロゲン原子を表すか、またはアニオンL G_8 中の基Qの一部分がヒドロキシ基を表し、およびWがLの原子価+1に相当する整数を表す。)で表わされる化合物である。

【0026】炭素原子数6ないし18のアリール基の例 は、フェニル基、ナフチル基、アントリル基およびフェ ナントリル基である。適した基に存在する置換基は、ア ルキル基、好ましくは炭素原子数1ないし6のアルキル 基、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソ プロビル基、n-ブチル基、第二ブチル基、イソブチル 基、第三-プチル基および種々のペンチル基またはヘキ シル異性体、アルコキシ基、好ましくは炭素原子数1な いし6のアルコキシ基、例えばメトキシ基、エトキシ 基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペントキシ基およびへ 30 キシルオキシ基、アルキルチオ基、好ましくは炭素原子 数1ないし6のアルキルチオ基、例えばメチルチオ基、 エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基、ペンチ ルチオ基またはヘキシルチオ基、ハロゲン原子、例えば フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、ア ミノ基、シアノ基、ニトロ基またはアリールチオ基、例 えばフェニルチオ基である。特に有利なハロゲン原子Q の例は、塩素原子および好ましくはフッ素原子であり、 アニオンLQw - の例は特にBF4 - 、PF6 - 、As F。 - 、SbF。 - およびSbF。(OH) - である。 40 LQw - タイプのアニオンはまた、CF a SO a - によ り有利に置換することもできる。 分子中に 2 またそれ以 上のオニウム基を含む化合物、例えばジスルホニウム化 合物はもちろん開始剤として適当である。Gs,Gsお よびG,がフェニル基またはピフェニル基であり、また は該2つの化合物の混合物である式(3)のカチオン性 光開始剤化合物が特に頻繁に使用される。

【 0 0 2 7 】 カチオン性光開始剤の他の重要なタイプは 式 (4)

$$\left[G_{8}(F_{e}^{\Pi}G_{9})_{c}\right]_{A}^{+c}\left[T\right]_{c}^{-d} \tag{4}$$

(式中 cが1または2を表し、dが1, 2, 3, 4ま たは5を表し、Tが求核性でないアニオン、例えば、B F_4 - PF_6 - AsF_6 - SbF_6 - CF_3 S O_3 - C_2 F_5 SO_3 - $n-C_3$ F_7 SO_3 - n $-C_4 F_9 SO_3^-, n-C_6 F_{13}SO_3^-, n-C_8$ F_{1} , SO_3 , C_6 , F_5 , SO_3 , UV $(PO_{40}W_{12}^{3})$ shall be shall b $O_{40}W_{12}$ ⁴ つ) を表し、 G_8 が π -アレーン基を表し、 およびG。が π -アレーン基のアニオン、特にシクロペ ンタジエニルアニオンを表す。) で表わされる。

【0028】ここで適当なπアレーンG。およびπーア レーンG。のアニオンの例はEP-A-94915に示 される。重要な π アレーン例は、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、クメン、メトキシベンゼン、メチルナ フタレン、ピレン、ペリレン、スチルベン、ジフェニレ ンオキサイドおよびジフェニレンスルフィドである。特 に好ましいものはクメン、メチルナフタレンまたはスチ ルベンで示される。アニオンTは特にPF。-,AsF 6 -, SbF6 -, CF3 SO3 -, C2 F5S O_3 $\bar{}$, $n\!-\!C_3$ F_7 $S\,O_3$ $\bar{}$, $n\!-\!C_4$ F_9 S O_3^- , $n-C_6$ $F_{13}SO_3^ f_{17}SO_{17}$ 3 である。メタロセン塩のようなフェロセン塩は一般 に、また酸化剤と共に使用されうる。該組成物はEPー A-126712号に開示されている。

【0029】カチオン性光開始剤はもちろん、慣用の有 効量、例えばおのおの場合、混合物の総量に基づいて約 0. 1ないし20重量%、好ましくは1ないし10重量 %で添加できる。光収率(light yeild) を増加するため に、開始剤の型に依存して、増感剤を使用することも可 能である。これらの例はポリ環状芳香族炭化水素または 芳香族ケト化合物である。好ましい増感剤の特別な例は EP-A-153904号に開示されている。

【0030】液状放射線-硬化性組成物はまた光重合性 材料の技術において通常使用される他の構成成分、例え ば、特定の成分に適当な不活性溶媒、あるいは安定剤の ような慣用の添加剤、例えばUV安定剤、離型剤、湿潤 剤、流量調節剤、沈降防止剤、界面活性剤、染料、顔料 40 または充填剤を含むことも可能である。上記添加物はお のおの場合、所望の目的のための有効量で使用され、新 規な組成物の例えば合計20重量%まで量を構成する。 【0031】新規な安定化方法はステレオリソグラフィ ーにおける使用に特に適当である。従って、本発明は、 カチオン重合性化合物およびカチオン重合用光開始剤と からなる液状放射線ー硬化性組成物を使用するステレオ リソグラフィーによる立体製品の製造方法であって、塩 基性イオン交換体を組成物と接触させそして少なくとも

物の放射線と接触するようになる部分から取り除く方法 に関する。

【0032】上記ステレオリソグラフィー法では、上に 概記したようにイオン交換体は好ましくは、全くイオン 交換体に不透過性であるが、少なくともある領域で硬化 性組成物に透過する容器内に置かれる。この容器はステ レオリソグラフィー槽内に少なくとも一定の期間、導入 される。

【0033】イオン交換体および全ての槽材料間で可能 な最も強い接触が可能となるので、容器がステレオリソ グラフィー槽内にある間、該槽中の液状組成物と該容器 間に相対的運動 (relative movement)が起こることはさ らに好ましい。

【0034】この場合にステレオリソグラフィーのため に特に適当な液状硬化性組成物はカチオン硬化性化合物 として特に、液状エポキシ樹脂、例えば上記で言及した エポキシ樹脂をベースとする。これらは特に好ましくは いわゆるハイブリッド系、即ち、フリーラジカルによっ て硬化できる化合物の少なくとも1種およびそのために 適当なフリーラジカル重合光開始剤ならびにカチオン硬 化性成分を含む組成物である。このようなハイブリッド 系は例えばその記載が本発明の一部分と見なされる、E P-A-0360869号およびEP-A-06053 61号に記載される。

【0035】フリーラジカルにより重合できる化合物 は、例えば組成物全体に基づいて0ないし80重量%の 量で使用できる。例えば、上記組成物は、フリーラジカ ルにより硬化できる成分5ないし30重量%およびカチ オン硬化性成分70ないし95重量%を含む。フリーラ 30 ジカルにより重合可能な化合物は多くは9個までのアク リレート官能価を有するモノアクリレート、ジアクリレ ートおよびポリアクリレートもしくは相当するメタクリ レートまたは6個までのビニル官能価を有するビニル化 合物である。

【0036】適当なモノ(メタ)アクリレートの例は、 アクリレート;アリルメタクリレート;メチル、エチ ル、nープロピル、nーブチル、イソブチル、n-ヘキ シル、2-エチルヘキシル、n-オクチル、n-デシル およびn-ドデシルアクリレートおよびメタクリレー ト;2-ヒドロキシエチル、2-および3-ヒドロキシ プロピルアクリレートおよびメタクリレート;2-メト キシエチル、2-エトキシエチルおよび2-もしくは3 -エトキシプロピルアクリレート;テトラヒドロフルフ リルメタクリレート;2-(2-エトキシエトキシ)エ チルアクリレート;シクロヘキシルメタクリレート;2 -フェノキシエチルアクリレート;グリシジルアクリレ ートおよびイソデシルアクリレートであり;ならびに適 当なモノーNービニル化合物の例はnービニルピロリド ンおよびN-ビニルカプロラクタムである。このような 放射線-硬化の進み始め時点より、放射線-感受性組成 50 製品は公知であり、また幾つかは商業的に、例えばサー

トーマー社 (SARTOMER Company) から 入手可能である。

【0037】適当なさらなるジ(メタ)アクリレートの例は環状脂肪族または芳香族ジオールのジ(メタ)アクリレート、例えば1, 4 – ジヒドロキシメチルシクロヘキサン、2, 2 – ビス(4 – ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン、ビス(4 – ヒドロキシシクロヘキシル)メタン、ヒドロキノン、4, 4 $^{\prime}$ – ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェ*

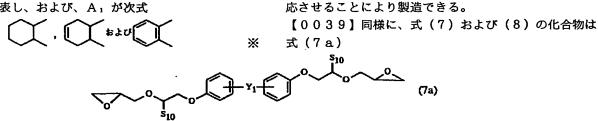
.

*ノールS、エトキシル化またはプロポキシル化ビスフェ ノールA、エトキシル化もしくはプロポキシル化ビスフェノールFまたは、エトキシル化もしくはプロポキシル 化ビスフェノールSである。該ジ(メタ)アクリレート は公知であり、またそのうちの幾つかは商業的に入手可 能である。

【0038】ジ(メタ) アクリレートはまた式(5)、(6)、(7) または(8)

※で表わされる基を表す。)

(式中、 S_1 は水素原子またはメチル基を表し; Y_1 が 直接結合,炭素原子数 1 ないし 6 のアルキレン基, $-S_1$ のの一、 $-S_1$ のの一、 $-S_1$ のの一、 $-S_1$ のの一を表 30 し; S_1 のが炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基、未置換または 1 以上の炭素原子数 1 ないし 4 のアルキル基、ヒドロキシ基もしくはハロゲン原子により置換されたフェニル基、または式 $-C_1$ の S_1 で表わされる基を表し; S_1 が炭素原子数 1 ないし 1 のアルキル基またはフェニル基を表し、および、1 が次式



で表されるジグリシジルエーテルまたは式 (8 a)

(上記各式中、Sio、Yi およびAi は上記で定義した

と同じ意味を表す。)で表されるジグリシジルエステルと、(メタ)アクリル酸とを反応させることにより製造できる。

式(5)および(6)で表されるジ(メタ)アクリレー

トは公知であり、そして幾つかのものは、例えば登録商

標SR 349および登録商標Novacure 37 00のもとに市販されており、そしてエトキシル化ビフ

ェノール、特にエトキシル化ビスフェノールAまたはビスフェノールジグリシジルエーテル、特にビスフェノー

ルAジグリシジルエーテルと (メタ) アクリル酸とを反

【0040】ジアクリレートはさらにまた、式(9)、(10)、(11)または(12)

で表される化合物が可能である。

【0041】これらの化合物は公知であり、幾つかは市*

*販されている。式(9)および(10)で表される化合 物は式 (9a) または (10a)

30

で表される脂環式ジェポキシドをそれぞれ (メタ) アク リル酸と反応させることによる公知の方法で製造でき る。式(12)で表される化合物は登録商標 Kayar ad R-604の名称のもとで市販されている。

【0042】適当なさらに別のポリ(メタ)アクリレー トは2より多くの(メタ)アクリレート官能価、特にト リー、テトラーまたはペンター官能性アクリレートおよ びメタクリレートをもつ単量体または低重合体脂肪族、 環状脂肪族または芳香族アクリレートまたはメタアクリ レートである。

【0043】適当な脂肪族多官能性(メター)アクリレ ートの例は、ヘキサン-2,4,6-トリオールグリセ ロールまたは1,1,1ートリメチロールプロパンのト リアクリレートおよびトリメタクリレート、エトキシル 化もしくはプロポキシル化グリセロールまたは1,1, 1-トリメチロールプロパンおよびトリエポキシド化合 物、例えば前記したトリオールのトリグリシジリエーテ ルと(メター)アクリル酸との反応により得られるヒド ロキシル含有トリ (メタ) アクリレートである。また例 えば、ペンタエリトリトールテトラアクリレート、ピス トリメチロールプロパンテトラアクリレート、ペンタエ リトリトールモノヒドロキシトリーアクリレートもしく はメタアクリレートまたはジペンタエリトリトールモノ 50

ヒドロキシペンターアクリレートもしくはーメタアクリ レートを使用することも可能である。

【0044】新規な組成物では、フリーラジカルにより 重合可能な他の化合物は6官能性または多官能性ウレタ ンアクリレートもしくはウレタンメタクリレートでもあ ってよい。これらのウレタン (メタ) アクリレートは当 業者に公知であり、および例えばヒドロキシ基末端のポ リウレタンとアクリル酸もしくはメタクリル酸を反応さ せることによる、またはイソシアネート基末端のプレポ リマーとヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートを反 応させることによる公知の方法によって製造できる。

【0045】適当な芳香族トリ(メタ)アクリレートの 例は、三価フェノールのトリグリシジルエーテルの反応 生成物、および3つのヒドロキシ基と(メタ)ーアクリ ル酸を有するフェノールまたはクレゾールノボラックで ある。

【0046】新規な組成物は好ましくは組成物に可溶な 1ないし9のアクリレート官能価を有する(メタ)アク リレートの少なくとも1つを含む;それらは特に好まし くは2ないし9のアクリレート官能価を有する芳香族、 脂肪族または脂環式(メタ)アクリレートの液体混合物 を含む。

【0047】フリーラジカル重合用の他の適当な光開始

化合物およびその作用機作は公知であり、例えばEP-A-0223587およびUS-A-4751102; 4772530および4772541に開示されている。言及し得る適したイオン染料-カウンターイオン化合物の例はアニオン染料-ヨードニウムイオン錯体、アニオン染料-ピリリウムイオン錯体および特に次式:

18

R" R"" X+

(式中 X*はカチオン染料およびR'、R"、R"がおよびR"は各々独立してアルキル基、アリール基、アルカリル基、アリル基、アラルキル基、アルケニル基、アルケニル基、アルキニル基、または脂環式または飽和もしくは不飽和複素環式基を表す。)で表されるカチオン染料ーポレートアニオン錯体である。

【0051】各々の選択された光源のために適した光開 始剤を選択し、そして必要に応じて増感されなければな らないということが当業者に知られている。重合された 組成物への輻射線の浸透深さおよび加工速度は、前記光 開始剤の吸収係数および濃度に直接的に相関するという ことが認識されている。ステレオリソグラフィーにおい ては、好ましいものは、設定した硬化深度において最適 の強さのプレフォームが形成されるように、最も多くの フリーラジカルもしくはカチオン性粒子を発生させる光 開始剤に示される。本質的には、特にレーザーが放射線 硬化のために使用される場合、カチオンおよびフリーラ ジカル光開始剤はステレオリソグラフィー混合物に、光 開始剤の有効量、特に混合物の全含有量に基づき0.1 ないし10重量%が添加され、通常のレーザー速度対す る硬化深度を約0.1ないし2.5mmにするように混 合物の吸収能が光開始剤のタイプおよび濃度によって調 整される。

【0052】もちろん、この技術の通常の添加剤を、本発明のためのステレオリソグラフィー槽内に存在させることも可能である。これらは、例えば、上記添加剤または追加の架橋剤、例えばジオールまたはポリオールである。

【0053】新規な安定化とは別に、ステレオリソグラフィー法は当然、例えばUS-A-4575330号またはEP-A-0605361号に記載されるいずれかの慣用の方法で行うことができる。

[0054]

40

【実施例】以下に本発明の他の例を示す。

実施例1: 湿潤の弱塩基性イオン交換体〔ローム アンド ハース社(Roham & Haas)からの登録商標アンバーリスト(Amberlyst) A 2 1〕 2 0 0 gを無水エタノール3 0 0 m l で3回および酢酸エチル3 0 0 m l で3回洗浄し、おのおのの洗浄後、前記交換体材料を吸引乾燥す

剤は好適な照射においてフリーラジカルを形成する全て の化合物のタイプである。代表的な公知の光開始剤は、 ベンゾイン、例えばベンゾイン類、ベンゾインメチルエ ーテル、ベンゾインエチルエーテルおよびベンゾインイ ソプロビルエーテル、ベンゾインフェニルエーテルのよ うなペンゾインエーテル、ペンゾインアセテート;アセ トフェノン類、例えばアセトフェノン、2,2-ジメト キシアセトフェノンおよび1,1-ジクロロアセトフェ ノン;ベンジル、ベンジルケタール類例えばベンジルジ メチルケタールおよびペンジルジエチルケタール;アン 10 トラキノン類、例えば2-メチルアントラキノン、2-エチルアントラキノン、2-第三プチルアントラキノ ン、1-クロロアントラキノンおよび2-アミルアント ラキノン;さらにまたトリフェニルホスフィン;ベンゾ イルホスフィンオキシド例えば2、4、6ートリメチル ベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド〔ルツィリン (Luzirin) TPO];ベンゾフェノン類例えばベンゾ フェノンおよび4, 4′-ビス (N, N′-ジメチルア ミノ) ベンゾフェノン;チオキサントン類およびキサン トン類;アクリジン誘導体;フェナジン誘導体;キノキ 20 サリン誘導体または1-フェニル-1,2-プロパンジ オン、2-0-ペンゾイルオキシム;1-アミノフェニ ルケトン、または1-ヒドロキシフェニルケトン例えば 1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、フェニ ル1ーヒドロキシイソプロピルケトンおよび4ーイソプ ロビルフェニル1-ヒドロキシイソプロビルケトンであ り、これらは全て公知である。

【0048】通常、光源としてのHeCdレーザーと組み合わせて使用される特に適当な光開始剤は、2,2ージアルコキシベンゾフェノンのようなアセトフェノンお 30よび1ーヒドロキシフェニルケトン、例えば1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンもしくは(2ーヒドロキシイソプロピル)フェニルケトン(=2ーヒドロキシー2,2ージメチルアセトフェノン)であり、特に1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンである。

【0049】アルゴンーイオンレーザーが使用される際に通常使用される、フリーラジカル光開始剤の他の類は、ベンジルケタールからなり、それは、例えば、ベンジルジメチルケタールである。特に α ーヒドロキシフェニルケトン、ベンジルジメチルケタールまたは2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスヒンオキサイドが光開始剤として使用される。

【0050】他の適当な光開始剤はイオン染料 – カウンターイオン化合物からなり、該化合物は化学線を吸収し、そして(メタ)アクリレートまたはビニル化合物のような物質の重合を開始させるフリーラジカルを生成することができる。イオン染料 – カウンターイオン化合物を含む本発明の混合物は400ないし700nmの適した波長範囲内の可視線を使用してこのような変化し得る硬化することができる。イオン染料 – カウンターイオン50

20

る。このように洗浄したイオン交換樹脂を最後に60 ℃、0.1hPaの圧力下で一夜乾燥する。カチオン重 合性化合物として、市販の、エポキシ樹脂をベースとす るステレオリソグラフィー用の組成物である、登録商標 チバツール(cibatool) SL5180の100gおよび カチオン重合用の光開始剤として下式

で表されるスルホニウム塩、ならびにフリーラジカルに より重合可能な他の成分(ハイブリッド系)を上記イオ ン交換体1gと一緒に褐色ガラス瓶に装入し、そして混 合物を80℃の熱対流炉で24時間、促進老化試験にか ける。加熱前と同様に組成物の粘度(21番スピンドル 用いるブルックフィールド粘度計を使用して30℃で測 定される) は正確に180mPa·sである。対照とし て、組成物にイオン交換体を添加しない場合には、80 ℃のオーブン内で24時間貯蔵した後の樹脂の粘度は1 90mPa・sである。(同様に、21番スピンドルを 用いるブルックフィールド粘度計を使用して30℃で測 定される。)

感光性は、Dr. ポール F ジェイコブズ(Dr. Paul F Jakobs) 著、「RAPID PROTOTYPING & MANUFACTURING & MANUFACTURING, FUNDAMENTALS OF STEREOLITHOGRAPH Y」、SME社刊、アメリカ合衆国、ミシガン州、ディ *

*アポーン (Dearborn, Michigan, USA), 263-277
頁に記載されており、20mWで351nm放射線をも
つAr/UVレーザーを用いる、いわゆる「ウインドウ
-パン法(window-pane method)」を使用して測定され
る。イオン交換体を含む組成物については、80℃で2
4時間貯蔵後に放射線透過度Dp約0.17mmおよび
臨界エネルギー (Critical energy)Ec22.3mJ/
c m³ が測定され、即ち、新しい溶液に対するこれらの
値〔放射線透過度Dp約0.17mmおよび臨界エネル
ギーEc22.3mJ/cm³ 〕に匹敵する。

【0055】実施例2

TRAPID PROTOTYPING SYSTEMS: FAST TRACK TO PRODUCT REALIZATION」としてSME社刊,アメリカ合衆国,ミ シガン州, ディアポーン 48121 (Dearborn, Mi48121, U SA), 68ページ以降に記載されているように登録商標 クイックラスト(Quicklast) の設計で80×4×4mm の寸法をとる10個のプレフォームを、総量100gの 登録商標チバツールSL5180を含む槽から、ステレ オリソグラフィーにより製造する。ストリップを槽に7 日間放置する(試験試料1)。試験試料2は新たに調整 された登録商標チバツールSL5180であり、そして 試験試料3は弱イオン交換体登録商標アンバーリストA 21 (未洗浄)の1重量%を含む新たに調整されたチバ ツールSL5180である。試料は80℃の炉に21日 間貯蔵され、その間、その粘度を21番のスピンドルを もつブルックフィールド粘度計を使用して30℃で数日 の間隔で測定する。以下に示す粘度が見出される。

			粘度	[mra·s]
		試料 1	試料	2 試料3
C) 日間貯蔵後	156	1 5	6 156
5	日間	_	_	2 4 9
6	日間	10700	8 1	8 –
9	日間	ゲル化	151	0 364
1 2	2日間		3 4 2	0 4 1 1
1 4	日間		6 1 8	0 -
1 6	6日間		1210	0 503
2 1	日間		ゲル	化 –
2 4	日間			6 1 8

実施例は試料1がたった9日間でゲル化することを明瞭 40%に記載の洗浄したイオン交換樹脂0.1gと共に褐色ガ に示す。酸が槽中の未硬化成形品 (green part) から拡 散し、そして未硬化成形品のこのプロトンの拡散は慣用 の未安定化ステレオリソグラフィー槽の粘度のかなりの 増加の原因となる。新しい組成物 (試料2) はまた、貯 蔵中に迅速な粘度の増加をまた示し、一方本発明により 安定化された試料3は粘度の最少の増加のみを示す。

【0056】<u>実施例3</u>

登録商標チバツールSL5180

ラス瓶に装填し、混合物を80℃の熱対流炉で26日 間、促進老化試験にかける。試験試料の粘度(21番の スピンドルを用いるブルックフィールド粘度計を使用し て30℃で測定される。)を数日の間隔で測定する。感 光性を同時にウインドウーバン法(実施例1と同じ条 件)でアルゴン/紫外線レーザーを使用して測定する。 以下の値が得られる。

100gを実施例1※

貯蔵時間

粘度

放射線透過

臨界(Critical)

エネルギー

21			22
	$[mPa \cdot s]$	[mm]	$[mJ/cm^2]$
0 日間	156	0.18	23.9
11日間	2 1 4	0.19	27.5
26日間	260	0.18	2 8

【0057】 実施例4

で表される光開始剤 0.5 g、式

で表される光開始剤3gおよびピレン0.1gを褐色ガ

ラス瓶中で混合し、そして混合物を促進老化試験に80 ℃の炉中で20日間かける(試験試料1)。同じ混合物 100gを洗浄したアンパーリストA21タイプのイオ ン交換樹脂0.1gと混合しそして同様の試験にかける (試験試料2)。試験試料の粘度(21番のスピンドル 10 を用いるブルックフィールド粘度計を使用して30℃で 測定される。)を数日の間隔で測定し、以下の値を得 る。

貯蔵時間	試験試料 1 粘度 [mPa·s]	試験試料 2 粘度 [mPa・s]
0 日間	336	3 3 6
10日間	1290	459
13日間	2020	508
20日間	5460	660

フロントページの続き

// B 2 9 K 105:24

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

20

技術表示箇所

(72)発明者 ベッティナ シュタインマン スイス国,1724 プラロマン,レ ルシル

(番地表示なし)

(72)発明者 マンフレッド ホフマン

スイス国, 1723 マルリー, ルート ベル

エール 38